(19) 世界知的所有権機関 国際事務局



(43) 国際公開日 2003年12月18日(18.12.2003)

PCT

(10) 国際公開番号 WO 03/104334 A1

男山弓岡2番地B23-502号 Kyoto (JP). 山崎 康 寬_(YAMASAKI,Yasuhiro) [JP/JP]; 〒572-0019 大阪府 寝屋川市 三井南町30番3-308号 Osaka (JP).

(51) 国際特許分類7:

47/067, 47/08, C07D 487/22, G03G 5/06

(21) 国際出願番号:

C09B 47/12,

PCT/JP03/07240

(22) 国際出願日:

2003 年6 月9 日 (09.06.2003)

(25) 国際出願の言語:

日本語

(26) 国際公開の言語:

日本語

(81) 指定国 (国内): JP, KR, US.

(30) 優先権データ: 2002年6月10日(10.06.2002) 特願2002-168580 JP

(84) 指定国 (広域): ヨーロッパ特許 (AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HU, IE, IT, LU, MC, NL, PT, RO, SE, SI, SK, TR).

(74) 代理人: 河宮治,外(KAWAMIYA,Osamu et al.); 〒 540-0001 大阪府 大阪市 中央区城見 1 丁目 3 番 7 号

IMPビル 青山特許事務所 Osaka (JP).

(71) 出願人 (米国を除く全ての指定国について): オリヱン ト化学工業株式会社 (ORIENT CHEMICAL INDUS-TRIES, LTD.) [JP/JP]; 〒535-0022 大阪府 大阪市 旭区 新森1丁目7番14号 Osaka (JP).

添付公開書類:

国際調査報告書

(72) 発明者: および

(75) 発明者/出願人 (米国についてのみ): 髙木 謙治

2文字コード及び他の略語については、 定期発行される 各PCTガゼットの巻頭に掲載されている「コードと略語 のガイダンスノート」を参照。

(54) Title: μ -OXO CROSSLINKED DISSIMILAR METAL PHTHALOCYANINE COMPOUND AND PROCESS FOR SELEC-TIVELY PRODUCING THE SAME

(54) 発明の名称: μ-オキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物及びその選択的製造方法

(57) Abstract: Novel μ -oxo crosslinked dissimilar metal phthalocyanine compound; and a process for selectively producing the μ -oxo crosslinked dissimilar metal phthalocyanine compound in a simple manner with high yield. This μ -oxo crosslinked dissimilar metal phthalocyanine compound comprises a metal phthalocyanine containing central metal M1 and a metal phthalocyanine containing central metal M2, the central metals M1 and M2 oxo crosslinked to each other.

(57)要約:新規なμ-オキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物、およびそのμ-オキソ架橋型異種金属フタロシ アニン化合物を、簡便で、且つ選択的に高収率で得られる製造方法が開示されている。このμ-オキソ架橋型異種 金属フタロシアニン化合物は、中心金属としてM1を含む金属フタロシアニンと中心金属としてM2を含む金属フ タロシアニンの中心金属原子同士(M1、M2)がオキソ架橋した化合物である。

明 細 書

μーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物及びその選択的製造方法

技術分野

5

10

15

20

25

本発明は、有機感光体等の電荷発生材料、光導電性材料、光記録材料、有機太陽電池材料、非線形光学材料等に有用な、新規なμーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物及びその製造方法に関する。

背景技術

金属フタロシアニン系化合物は、半導体レーザーの発信波長域である800n m前後に感度を有する有機光導電性物質として注目されている。このような有機 光導電性物質を有効成分とする有機感光体(OPC)は多数提案されており、例 えば、チタニルフタロシアニン系化合物を電荷発生材料として用いた有機感光体 が実用化されている。

また、最近では、発光ダイオード(LED)の普及等による光源の短波長化やカラーレーザービームプリンター(LBP)用OPC等に適した、新たな性能が付与された中一高感度を有する電荷発生材料の探索も精力的に行われている。

光の照射によってフタロシアニン(Pc)化合物は電荷を発生し、その結晶変態、 中心金属の有無および種類などにより様々な電気特性を示すことが知られている。

例えば、2種または2種以上のフタロシアニン化合物の混合結晶に関して、特開平2-272067号には、無金属フタロシアニンに、該無金属フタロシアニンに対して同量以下のチタニルフタロシアニンを加えた後、攪拌を行って結晶転移を行わしめるX型無金属フタロシアニン組成物の製造方法が記載されている。特開平4-351673号には、オキシチタニウムフタロシアニンと少なくとも1種のヒドロキシメタルフタロシアニンとからなる混合結晶が記載されている。特開平4-184452号には、チタニルフタロシアニンと多層型フタロシアニン誘導体とを含有する塗布液が記載されており、感光体に用いられている。特開平8-67829号には、フタロシアニン系化合物の少なくとも2種以上を酸に溶解させ、これを水と誘電率20以下の有機溶媒の混合液に添加し、フタロシアニン混晶体として析出させることを特徴とするフタロシアニン混晶体の製造方法

10

15

20

25

が記載されている。特開2002-12790号には、少なくとも3種の中心物質の異なるフタロシアニンからなる混晶が記載されている。

さらに、特開平9-217020号には新規な結晶変態を有する μ -オキソーアルミニウムフタロシアニン二量体が記載されており、特開平10-88023号には μ -オキソーガリウムフタロシアニン二量体が記載されている。また、特開平7-295259号には、アルコキシ橋かけ金属フタロシアニン二量体が記載されている。

特開平6-145550号には、チタニルフタロシアニン及び中心金属が3価のハロゲン化金属フタロシアニンを含むフタロシアニン混合物を、アシッドペースティング法により水中に再沈させる方法が記載されている。しかしながら、上記文献には、 μ ーオキソ架橋型の化合物についての記載はなく、またそれらを選択的に得ることについての記載もない。

 μ ーオキソ異種金属フタロシアニン二量体に関して、特開 2000 ー 2198 17号には、 μ ーオキソーアルミニウム/ガリウムフタロシアニン二量体が記載されている。しかしながら、ここに記載のフタロシアニン二量体は、確率論的に必ず、 μ ーオキソアルミニウムフタロシアニン二量体と μ ーオキソガリウムフタロシアニン二量体との3種の混合物として得られるものである。

また、米国特許第4900817号には、例えば、(HO)GePc-O-SiPcOSi(C_6H_{13})。であるような多環フタロシアニン化合物が記載されている。しかしながら、この多環フタロシアニン化合物は、中心金属が4価のSiやGeである。また、その製法はヒドロキシ基置換金属(IV)フタロシアニンの有機溶剤中での脱水反応によるものである。

発明の開示

発明が解決しようとする技術的課題

本発明は、電荷発生材料として、有機感光体に光感度や電気特性について多様性をもたせることができる、新規な μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物を提供することを目的とする。また、本発明は、この μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物が簡便且つ選択的に高収率で得られる製造方法を提供することを目的とする。

10

15

20

その解決方法

すなわち、本発明は、式

[式中、M1 は最大3の原子価をとることができる金属原子(但しインジウムを除く)を表し、M2 は4の原子価をとることができる金属原子を表し、R はそれぞれ独立して1またはそれ以上の置換基および/または置換原子を表し、 (A^m-1) はM2 はM3 がの原子価に対応して0または $1\sim3$ から選択される整数を表し、M3 がはM3 を表す。]

で示される μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物を提供するものであり、そのことにより上記の目的を達成できる。

また、本発明は、中心金属がハロゲン化金属(III)であるフタロシアニンと中心金属がオキシ金属(IV)であるフタロシアニンとを等モルづつ反応させる工程を包含する、 μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物の製造方法を提供するものであり、そのことにより上記の目的を達成できる。

さらに、本発明は、中心金属がハロゲン化金属(III)であるフタロシアニンと中心金属がオキシ金属(IV)であるフタロシアニンとを等モルづつ反応させる工程、および得られた化合物をアンモニア水を用いて洗浄する工程を包含する、 μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物の製造方法を提供するものであり、そのことにより上記の目的を達成できる。

図面の簡単な説明

図1は、実施例1のXRDスペクトルである。

図2は、実施例1のTOF-MSスペクトルである。

25 図3は、実施例2のXRDスペクトルである。

10

15

20

25

図4は、実施例2のTOF-MSスペクトルである。

図5は、実施例4のXRDスペクトルである。

図6は、実施例4のTOF-MSスペクトルである。

図7は、実施例6のTOF-MSスペクトルである。

図8は、実施例7のTOF-MSスペクトルである。

図9は、実施例7の¹ H-NMRスペクトルである。

図10は、実施例7の¹³ C-NMRスペクトルである。

図11は、実施例7のIRスペクトルである。

図12は、実施例7の近紫外-可視-近赤外吸光スペクトルである。

図13は、比較例2のTOF-MSスペクトルである。

発明の詳細な説明

本発明の μ — オキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物は、中心金属として M1を含む金属フタロシアニンと中心金属としてM2を含む金属フタロシアニン の中心金属原子同士(M1、M2)がオキソ架橋した構造の化合物である。M1 は、最大3の原子価をとることができる金属原子を意味する。例えば周期表3A族(例えばSc、Y)もしくは3B族(例えばA1、Ga、In、T1)の金属原子 はM1に含まれる。M2は4の原子価をとることができる金属原子を意味する。例えば周期表4A~7A族、8族、および4B~6B族の金属原子はM2に含まれる。周期表3A族もしくは3B族の金属原子(例えばA1、Ga)はM2に含まれない。尚、 μ — オキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物の構造中に含まれる状態では、M2は3価の形態で存在していてもよい。

本発明の μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物は、それらの芳香族環上にそれぞれ 1 以上の置換基および/または置換原子(R)を有していてもよい。置換基や置換原子の種類は、化合物中に安定に存在するものであれば特に限定されない。具体的には、アルキル基(例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、 t e r t ーブチル基、イソアミル基)、アルコキシ基(例えば、メトキシ基、エトキシ基、イソプロポキシ基、ブトキシ基)、フェノキシ基、アリール基(例えば、フェニル基、トリル基)、アラルキル基(例えば、ベンジル基)、アリル基、アルケニル基、シアノ基、ハロゲン原子

10

15

20

(例えば、C1、Br、I、F等)、カルボン酸エステル基、スルホン酸エステル基、ニトロ基、アミノ基等が挙げられる。

また、本発明の μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物は、中心金属原子(M2)の原子価に対応して正電荷(n^+)を帯びることがある。そのため、溶液中では通常、適当な対アニオン(A)を伴う形態で存在する。対アニオン(A)としては、例えばヒドロキシイオン(OH^-)、ハロゲンイオン(例えば $C1^-$)、硫酸水素イオン(HSO_3^-)等の1価の無機アニオン、あるいは硫酸イオン等の2価の無機アニオンが挙げられる。好ましくは、反応後、アンモニア水を用いて洗浄した場合のヒドロキシイオン(OH^-)である。

上記のμーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物は、中心金属がハロゲン化金属(III)であるフタロシアニン(以下、ハロゲン化金属フタロシアニンという。)と中心金属がオキシ金属(IV)であるフタロシアニン(以下、オキシ金属(IV)フタロシアニンという。)とを反応させて製造される。

ハロゲン化金属(III)フタロシアニンは、例えば、式

Α

[式中、RおよびM1は上記と同意義であり、Xはハロゲン原子を表す]で示される。

ハロゲン化金属(III)フタロシアニンは公知の方法を使用して得ることができる。例えば、1-クロロナフタレンまたはキノリンなどの高沸点有機溶媒中、フタロニトリル、1,3-ジイミノイソインドリン、あるいはそれらの誘導体を、3価の金属原子のハロゲン化物と共に反応させることにより得ることができる。さらに、生成物を、熱時濾過後、熱DMFおよびDMF等により洗浄することができる。ハロゲン化物のハロゲン原子はフッ素、塩素、臭素またはヨウ素であり、

10

15

20

好ましくは塩素である。

上記ハロゲン化金属(III)フタロシアニンの中心金属原子M1の好ましい例として、アルミニウム[A1(III)]、ガリウム[Ga(III)]が挙げられる。但し、M1としてインジウム[In(III)]を使用しないことが好ましい。中心金属がインジウムであるハロゲン化金属(III)フタロシアニンの場合、硫酸処理によってInがフタロシアニン環より脱離し、無金属フタロシアニンが副生するため、本発明の反応が生じにくくなるからである。

ハロゲン化金属(III)フタロシアニンとしては、好ましくはクロロガリウムフ タロシアニン、クロロアルミニウムフタロシアニンが挙げられる。

また、オキシ金属(IV)フタロシアニンは、例えば、式

В

[式中、RおよびM2は上記と同意義である] で示される。

オキシ金属(IV)フタロシアニンは公知の方法を使用して得ることができる。例えば、1ークロロナフタレンまたはキノリンなどの高沸点有機溶媒中、フタロニトリル、1,3ージイミノイソインドリン、あるいはそれらの誘導体を、3~6価の金属原子のハロゲン化物(例えば、塩化チタン、塩化バナジル、塩化モリブデン)と共に反応させ、次いで得られた(ジ)ハロゲン化金属フタロシアニンを加水分解することにより得ることができる。加水分解は、DMF等による洗浄によって起こり得るが、必要により稀塩酸水中で行うことが好ましい。

上記オキシ金属(IV)フタロシアニンの中心金属原子M2としては、チタン(Ti)、バナジウム(V)、モリブデン(Mo)、パラジウム(Pd)等が挙げられる。 好ましいオキシ金属(IV)フタロシアニンは、チタニルフタロシアニン [O=TiPc]、バナジルフタロシアニン [O=VPc]、オキシモリブデンフタロシア

10

15

20

25

ニン [O=MoPc] である。特に、チタニルフタロシアニンが好ましい。

例えばチタニルフタロシアニンは、一般に、1ークロロナフタレンまたはキノリンのような高沸点有機溶媒中、フタロニトリルもしくは1,3ージイミノイソインドリンをチタン塩化物(例えば、四塩化チタン)と共に反応させ、次いで、得られたクロロチタニウムフタロシアニンを、稀塩酸水中で加水分解することにより得ることができる。あるいは、フタロニトリルと四塩化チタンとを、アルコール溶媒中、プロトン授受型反応促進剤(例えば、1,8ージアザビシクロ[5.4.0]ウンデー7ーセン(DBU)または1,5ージアザビシクロ[4.3.0]ー5ーノネン(DBN))の存在下で加熱還流させ、得られたジクロロチタニウムフタロシアニンを稀塩酸水中で加水分解することにより得ることができる(特開平3ー21669号)。

本発明の μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物は、上記のハロゲン化金属(III)フタロシアニンとオキシ金属(IV)フタロシアニンとを反応させることにより製造できる。ハロゲン化金属(III)フタロシアニンと、オキシ金属(IV)フタロシアニンの混合モル比は1:1、等モルであり、且つ好ましい。この混合比での反応で、目的とする μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニンが高収率で選択的に得られるからである。

上記反応として、例えば、濃硫酸の存在下に、ハロゲン化金属(III)フタロシアニンとオキシ金属(IV)フタロシアニンとを等モルづつ混合して反応させる方法が挙げられる。濃硫酸として濃度95%以上の硫酸を使用するのが好ましい。

具体的には、ハロゲン化金属(III)フタロシアニンとオキシ金属(IV)フタロシアニンを、冷却下(例えば5℃以下)で濃硫酸に溶解して2~3時間反応させることができる。さらに、この反応後に、反応化合物を大量の水/氷中に注ぐことで化合物を析出させることができる。この操作によって化合物を微細化・精製することができる。

なお、反応物等を濃硫酸に溶解し、その溶解物を水/氷中に注ぐことで固体を 析出させて、微細化・精製する処理を「アシッドペースティング処理」という。 本発明では、いわゆるアシッドペースティング処理によって、ハロゲン化金属 (III)フタロシアニンとオキシ金属(IV)フタロシアニンとを反応させてμーオキ

10

15

20

25

ソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物が得られることとなる。

上記反応の後、得られた化合物をさらに引き続きアンモニア水を用いて洗浄することにより、反応化合物から酸根を簡便に除去することができる。具体的には、水およびアンモニア溶液に反応化合物を加え、次いで濾取した化合物を水およびイオン交換水で十分に洗浄し、乾燥することにより、化合物を簡便に精製することができる。使用に好ましいアンモニア水は濃度1%以上、好ましくは5~50%のものであり、特に濃度25%のアンモニア水を使用するのが好ましい。

この方法により μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物を簡便且つ選択的に高収率で製造することができる。

本発明の μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物の製造に好ましいハロゲン化金属(III)フタロシアニン/オキシ金属(IV)フタロシアニンの組合せとして、クロロガリウムフタロシアニン/チタニルフタロシアニン、クロロガリウムフタロシアニン/オキシモリブデンフタロシアニン、クロロアルミニウムフタロシアニン/チタニルフタロシアニン、クロロアルミニウムフタロシアニン/チタニルフタロシアニン、クロロアルミニウムフタロシアニン/オキシモリブデンフタロシアニン、クロロガリウムフタロシアニン/オキシパラジウムフタロシアニン等が挙げられる。さらに、これらのハロゲン化金属(III)フタロシアニン/オキシ金属(IV)フタロシアニンはそれらの芳香族環上に1以上の置換基および/または置換原子を有していてもよい。

このようにして得られる本発明のµーオキソ架橋型異種金属フタロシアニンは、 有機感光体等の電荷発生材料、光導電性材料、光記録材料、有機太陽電池材料、 非線形光学材料等に有用である。

発明の効果

本発明により、従来、選択的製造が困難なため混合系から分離・精製することで単品を得ていた、「 $D-\sigma-A$ 型色素」(ドナー色素(D)とアクセプター色素(A)が σ 結合でつながっている色素をいう。)である $\mu-$ オキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物が容易に得ることができる。この $\mu-$ オキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物は、有機感光体等の電荷発生材料、光導電性材料、光記録材料、有機太陽電池材料、非線形光学材料等に有用である。また、本発明

によって、分子内電子状態の分極を一義的に誘起できるμーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物を、ハロゲン化金属(III)フタロシアニンとオキシ金属(IV)フタロシアニンとを反応させることによる簡便で且つ選択的に高収率で得ることができる。

5 実施例

10

15

20

25

以下、合成例及び実施例により本発明を具体的に説明するが、本発明はこれらに限定されない。

合成例1

チタニルフタロシアニンの合成[特開平3-21669号、実施例1に記載の 方法]

フタロニトリル76. 2g(約0. 6mo1)、四塩化チタン56. 4g(約 0. 3mo1)、及びn-rミルアルコール200mlの混合物中に、加熱還流下1,8-ジアザビシクロ [5.4.0] ウンデー7-セン(DBU)91. 8g(約0. 6mo1)を約1時間かけて滴下し、さらに加熱還流下6時間攪拌した。反応終了後、100℃まで放冷し、水約30mlを加え、しばらく攪拌した後、生成物を濾取し、ジメチルホルムアミド(DMF)100ml、次いでメタノール100mlを振りかけ洗浄した。得られたジクロロチタニウムフタロシアニンを3%の塩酸水1000mlに分散し、p Hが6以上になるまで水洗した。次いでこの水湿潤ケーキを、予め100~120℃に加熱したDMF約500ml~投入し、この温度で約1時間攪拌した後、熱時濾過した。得られたDMF湿潤ケーキをメタノール100mlで置換して、乾燥し、チタニルフタロシアニン [O=TiPc]29.1gを得た。

合成例2

バナジルフタロシアニンの合成[特開平7-247442号、合成例1に記載の方法]

フタロニトリル32.5gと三塩化バナジウム10.0gとをキノリン125g中で235℃において5~6時間反応させ、生成物を濾取して後、200m1のDMF(ジメチルホルムアミド)で洗浄し、必要により稀塩酸水を用いて加水分解することによりバナジルフタロシアニン [O=VPc] 19.0gを得た。

合成例3

オキシモリブデンフタロシアニンの合成[特開平8-60021号、実施例2 に記載の方法]

フタロニトリル25.6gと三塩化モリブデン10.0gを1ークロロナフタレン150m1中で5時間反応させた。反応終了後、熱時生成物を収集し、ケーキをジメチルホルムアミド(DMF)で振り掛け洗浄した後、再度DMF120m1に分散させ、5時間攪拌還流後、再度熱時濾過を施し、メタノールでDMFを置換した。必要により稀塩酸水を用いて加水分解することにより、15.5gのオキシモリブデンフタロシアニン [O=MoPc] を得た。

合成例4

5

10

15

20

25

クロロガリウムフタロシアニンの合成 [特開平10-88023号、合成例1 に記載の方法]

四つロフラスコにフタロニトリル145.5g(1.13mol)と1ークロロナフタレン680ml及び塩化ガリウム(III)50.0g(0.284mol)を仕込み、加熱した。255℃で12時間還流下撹拌した。その後、還流を停止し、130℃程度まで放冷後熱時濾過して、熱ジメチルホルムアミド(100℃ DMF)2000ml、DMF1000mlを用いて振りかけ洗浄した。得られたケーキをDMF1500mlに再度分散し、3時間撹拌還流した後、110℃で熱時濾過後、熱DMF(110℃)1000ml、DMF1000mlを用いて振りかけ洗浄した。この操作を2度繰り返した後、得られたケーキをメタノール1000ml及び水1000mlで洗浄した後、70℃で乾燥して、クロロガリウムフタロシアニン [C1GaPc] 128.8g(収率73.5%)を得た。

合成例5

クロロアルミニウムフタロシアニンの合成 [特開平9-217020号、合成 例1に記載の方法]

4ロフラスコにフタロニトリル180.0g(1.41mol)と1ークロロナフタレン900ml及び塩化アルミニウム(III)47.0g(0.353mol)を仕込み、加熱した。240℃で6時間還流下撹拌した。その後、還流を停

止し、130℃程度まで放冷後熱時濾過して、熱トルエン(100℃) 180 0m1、トルエン80m1、アセトン900m1を用いて振りかけ洗浄し、トルエン100m1で置換した。得られたケーキをトルエン750m1中で3時間攪拌還流した後、100℃で熱時濾過後、熱トルエン(100℃) 1800m1、トルエン180m1、アセトン900m1で洗浄して、水400m1で溶媒置換した。得られたケーキを水4500m1に加え、70℃で1時間加熱分散した。熱時濾過後、アセトン900m1、水1000m1で洗浄し、70℃で乾燥してクロロアルミニウムフタロシアニン [C1A1Pc] 187.6g (収率92.5%)を得た。

10 合成例 6

5

15

20

25

合成例 4 で得られたクロロガリウムフタロシアニンを濃硫酸に溶解し、アシッドペースティング処理を行った。こうして得られた生成物は日本化学会誌 12, 878, 1997に記載されるように、ヒドロキシガリウムフタロシアニン(HOGaPc)と、 μ -オキソガリウムフタロシアニン二量体(PcGa-O-GaPc)の混合物であることがわかっている。

合成例7

テトラキスtertーブチルーチタニルフタロシアニンの合成

合成例1における出発物質(フタロニトリル)を、tertーブチルーフタロニトリルに代えたこと以外は、合成例1と同様にしてテトラキス tertーブチルーチタニルフタロシアニン $[O=TiPc(t-Bu)_4]$ を合成した。

合成例8

テトラキス t e r t ーブチルークロロガリウムフタロシアニンの合成 合成例 4 における出発物質(フタロニトリル)を t e r t ーブチルーフタロニトリルに代えたこと以外は、合成例 4 と同様にしてテトラキス t e r t ーブチルークロロガリウムフタロシアニン [ClGaPc(t-Bu)4] を合成した。 実施例 1

ClGaPc/OTiPc(1:1)系による μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物の合成

濃硫酸358gを5℃以下に冷却し、温度を保ちながらクロロガリウムフタロ

シアニン6.1g(0.010mol)及びチタニルフタロシアニン5.7g (0.010mol)の混合物を加え、5℃で2時間攪拌した。水0.6L(リットル)、氷1.4Lに10℃以下で滴下し、2時間分散した。静置後、減圧濾過し、水道水2.0Lで振りかけ洗浄した。ウエットケーキと水道水0.2Lを3Lビーカーに仕込み、2時間室温分散した。減圧濾過後、水道水2.0Lで振りかけ洗浄した。ウエットケーキ、水0.2L、25%アンモニア水0.15Lを1Lセパラブルフラスコに仕込み、6時間分散した。減圧濾過後、湯2.0L、イオン交換水1.0Lで振りかけ洗浄した。ウエットケーキを70℃で乾燥し、青色固体[化1]、10.7g(収率91.0%)を得た。

10 [化1]

5

15

20

この化合物 (PcGa-O-TiPc:分子量1175.64) の元素分析結果を表1に示す。

[表1]

	С	H	N	Ga	Ti
計算値	65. 38	2. 83	19. 06	5. 93	4. 07
実測値	66. 01	2. 49	18. 11	6. 00	3. 65

この化合物のX線回折スペクトル(XRDスペクトル)を図1に示す。また、この化合物のTOF-MS(飛行時間型質量分析)による質量分析スペクトルを図2に示す。

TOF-MSの測定は、「KOMPACT MALDI III」を用いて、検出モード「POSITIVE」、引き出し電圧「LOW(5KV)」、及び飛行モード「REFLECTION」で行った。

実施例2

ClGaPc/OVPc(1:1)系による $\mu-$ オキソ架橋型異種金属フタロシ

アニン化合物の合成

濃硫酸182gを5℃以下に冷却し、温度を保ちながらクロロガリウムフタロシアニン3.1g(0.005mol)及びバナジルフタロシアニン2.9g (0.005mol)の混合物を加え、5℃で2時間攪拌した。水0.3L、氷1.0Lに10℃以下で滴下し、2時間分散した。静置後、減圧濾過し、水道水2.0Lで振りかけ洗浄した。ウエットケーキと水道水0.2Lを3Lビーカーに仕込み、2時間室温分散した。減圧濾過後、水道水2.0Lで振りかけ洗浄した。ウエットケーキ、水0.2L、25%アンモニア水0.15Lを1Lセパラブルフラスコに仕込み、6時間分散した。減圧濾過後、湯2.0L、イオン交換水1.0Lで振りかけ洗浄した。ウエットケーキを70℃で乾燥し、青色固体[化2]、5.3g(収率90.0%)を得た。

[化2]

5

10

15

20

この化合物 (PcGa-O-VPc:分子量1178.72) の元素分析結果 を表 2 に示す。

[表 2]

	С	H	N	G a	V
計算値	65. 21	2. 82	19. 01	5. 92	4. 32
実測値	66. 71	2. 33	18. 71	5.84	4. 36

この化合物のXRDスペクトルを図3に示す。また、この化合物のTOF-M Sによる質量分析スペクトルを図4に示す。

実施例3

C1GaPc/OMoPc(1:1)系による μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物の合成

濃硫酸190gを5℃以下に冷却し、温度を保ちながらクロロガリウムフタロ

シアニン3. 1g(0.005mo1) 及びオキシモリブデンフタロシアニン3. 1g(0.005mo1) の混合物を加え、5 \mathbb{C} で2時間攪拌した。水0.3 \mathbb{L} 、 \mathbb{W} \mathbb{W}

[化3]

5

10

15

20

この化合物 (PcGa-O-MoPc:分子量1223.72) の元素分析結果を表3に示す。

[表3]

	С	H	N	G a	Мо
計算値	62. 82	2. 72	18. 31	5. 70	7.84
実測値	63. 99	2. 72	18. 35	6. 26	7. 69

実施例4

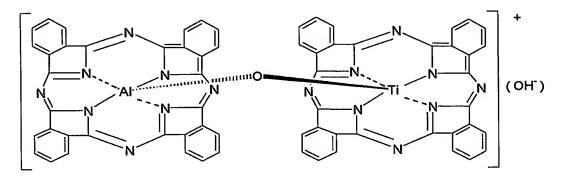
ClAlPc/OTiPc(1:1)系による μ -オキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物の合成

濃硫酸 176 gを 5 \mathbb{C} 以下に冷却し、温度を保ちながらクロロアルミニウムフタロシアニン 2.9 g (0.005 mo 1) 及びチタニルフタロシアニン 2.9 g (0.005 mo 1) の混合物を加え、5 \mathbb{C} で 2 時間攪拌した。水 0.4 L、1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0

ーカーに仕込み、2時間室温分散した。減圧濾過後、水道水1.5 Lで振りかけ洗浄した。ウエットケーキ、水0.2 L、25%アンモニア水0.15 Lを1 L セパラブルフラスコに仕込み、6時間分散した。減圧濾過後、湯1.5 L、イオン交換水1.5 Lで振りかけ洗浄した。ウエットケーキ30.4 gを70℃で乾燥し、青色固体[化4]、4.8 g(収率84.8%)を得た。

[化4]

5



この化合物 (PcAl-O-TiPc:分子量1132.90の元素分析結果を表4に示す。

10 [表4]

15

20

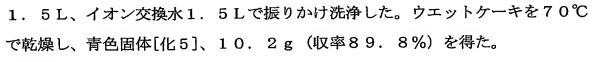
	С	H	N	A 1	T i
計算值	67. 85	2. 94	19. 78	2. 38	4. 23
実測値	66. 17	2. 39	18. 35	2. 24	4. 90

この化合物のXRDスペクトルを図5に示す。また、この化合物のTOF-M Sによる質量分析スペクトルを図6に示す。

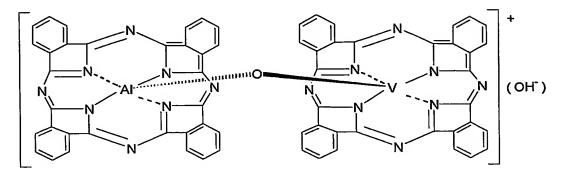
実施例5

C1A1Pc/OVPc(1:1)系による μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物の合成

濃硫酸 352 gを 5 C以下に冷却し、温度を保ちながらクロロアルミニウムフタロシアニン 5.8 g (0.010 mo 1) 及びバナジルフタロシアニン 5.8 g (0.010 mo 1) の混合物を加え、 5 Cで 2 時間攪拌した。水 0.5 L、氷 1.5 Lに 10 C以下で滴下し、 2 時間分散した。静置後、減圧濾過し、水 1.0 Lで振りかけ洗浄した。ウエットケーキと水道水 1.4 Lを 3 Lビーカーに仕込み、 2 時間室温分散した。ウエットケーキ、水 0.4 L、 25 %アンモニア水 0.2 Lを 1 Lセパラブルフラスコに仕込み、 6 時間分散した。減圧濾過後、湯



[化5]



この化合物 (PcAl-O-VPc:分子量1135.98) の元素分析結果を表5に示す。

[表 5]

5

10

15

20

	С	Н	N	A 1	V
計算值	67.67	2. 93	19. 73	2. 38	4. 48
実測値	69. 43	2. 49	19. 14	2. 20	4. 58

実施例6

 $ClGaPc/(tert-Bu)_4PcTi=O(1:1)$ 系による $\mu-J$ キソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物の合成

濃硫酸 74gを5 \mathbb{C} 以下に冷却し、温度を保ちながらクロロガリウムフタロシアニン1.16g(1.87mmol)及び(テトラ 1ert-ブチル)チタニルフタロシアニン1.50g(1.87mmol)の混合物を加え、5 \mathbb{C} で2時間攪拌した。水0.15 \mathbb{L} 、氷0.3 \mathbb{L} に10 \mathbb{C} 以下で滴下し、2時間分散した。静置後、減圧濾過し、水0.5 \mathbb{L} で振りかけ洗浄した。ウエットケーキと水道水0.65 \mathbb{L} を1 \mathbb{L} ビーカーに仕込み、2時間室温分散した。ウエットケーキ、水0.4 \mathbb{L} 、25%アンモニア水0.1 \mathbb{L} を1 \mathbb{L} セパラブルフラスコに仕込み、6時間分散した。減圧濾過後、湯0.5 \mathbb{L} 、イオン交換水1.0 \mathbb{L} で振りかけ洗浄した。ウエットケーキを70 \mathbb{C} で乾燥し、青色固体[化6]、1.84g(収率70.2%)を得た。

[化6]

この化合物(PcGa-O-TiPc(tert-Bu)₄:分子量1400. 07の元素分析結果を表6に示す。

[表 6]

5

10

15

	С	Н	N	Ga	Тi
計算値	68. 63	4. 68	16. 01	4. 98	3. 42
実測値	69. 05	4. 10	15. 32	5. 16	2. 76

また、この化合物のTOF-MSによる質量分析スペクトルを図7に示す。

実施例7

 $(tert-Bu)_4$ PcGaCl/ $(tert-Bu)_4$ PcTi=O(1:1)系による μ -オキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物の合成

濃硫酸 7 1 gを5℃以下に冷却し、温度を保ちながら(テトラtertーブチル)クロロガリウムフタロシアニン1.26g(1.50mmo1)、及び(テトラtertーブチル)チタニルフタロシアニン1.20g(1.50mmo1)の混合物を加え、5℃で2時間攪拌した。水0.2L、氷0.3Lに10℃以下で滴下し、2時間分散した。静置後、減圧濾過し、水1.8Lで振りかけ洗浄した。ウエットケーキと水道水0.4Lを1Lビーカーに仕込み、2時間室温分散した。ウエットケーキ、水0.2L、25%アンモニア水0.12Lを1Lセパラブルフラスコに仕込み、6時間分散した。減圧濾過後、湯1.0L、イオン交換水1.2Lで振りかけ洗浄した。ウエットケーキを70℃で乾燥し、青色固体[化7]、1.89g(収率77.5%)を得た。

[化7]

この化合物(分子量1624.5)の元素分析結果を表7に示す。

[表 7]

5

10

15

20

	С	Н	N	Ga	Ti
計算值	70. 98	6. 02	13. 80	4. 29	2. 95
実測値	72. 35	5. 82	14. 04	3. 65	3. 14

この化合物のTOF-MSによる質量分析スペクトルを図8に示す。また、 1 H-NMRスペクトルを図9に、 1 3 C-NMRスペクトルを図1 0に、 1 R スペクトルを図 1 1 に示し、可視一近赤外吸収スペクトルを図 1 1 に示す。

比較例1

 μ ーオキソアルミニウム/ガリウムフタロシアニン二量体の合成 [特開 2 0 0 0 - 2 1 9 8 1 7 号、実施例 1 に記載の方法]

濃硫酸 357gを氷ーメタノールで5℃以下に冷却し、温度を保ちながら合成例 4で得たクロロガリウムフタロシアニン6.17g(0.01mo1)と、合成例 5で得たクロロアルミニウムタロシアニン5.75g(0.01mo1)の混合物を加え、5℃以下で2時間攪拌した。これを氷1400g/水600m1 に、温度が10℃を越えないように撹拌しながら注加し、注加終了後さらに1時間分散した。静置後、上澄みを除去し、濾過した。水2000m1で洗浄した後、ケーキを水1800m1中で分散して、吸引濾過した。ケーキを水800m1で水洗した。水洗ケーキを温水550m1及び25%アンモニア水66m1に加え、還流下で6時間分散した。濾過後、ケーキを湯(60℃)600m1、イオン交換水(1EW)1650m1で洗浄した。濾液のpHと電導度がイオン交換水レベルとなったところで、70℃で乾燥し、10.5g(収率89.8%)の青色 固体を得た。

次いで、得られた青色固体 9. 0 g 2 e o - ジクロロベンゼン 150 m 1 を 300 m 1 のフラスコに仕込み、170 ~ 180 ℃で撹拌した。生成してくる水を除去しながら 10 時間還流攪拌した。130 ℃で熱時濾過後、熱DMF(110 ℃) 225 m 1、DMF 45 m 1、メタノール 90 m 1、IEW 225 m 1 で順次振りかけ洗浄した後、得られたケーキを 70 ℃で乾燥し、 μ 一 オキソーアルミニウム/ガリウムフタロシアニン二量体(PcA1 1 C の 1 を含む結晶変態を、混晶として 1 8. 1 4 g (収率 1 9 5%) 得た。

比較例 2

5

10

合成例1で得られたチタニルフタロシアニン(O=TiPc)と、合成例4で得られたクロロガリウムフタロシアニン(ClGaPc)とを等モルづつ単純に混合した試料を作成した。

この試料の元素分析結果を表8に示す。

[表8]

	С	Н	N	Ga	Τi	C 1
計算値	64. 37	2. 68	18. 77	5. 84	4. 01	2. 98
実測値	63. 24	2. 59	18. 21	6. 26	3. 81	2. 91

この化合物のTOF-MSによる質量分析スペクトルを図13に示す。

15 比較例 3

合成例1で得られたチタニルフタロシアニンと、合成例6のヒドロキシガリウムフタロシアニンと μ ーオキソガリウムフタロシアニン二量体の混合物であることが分かっている生成物を同量づつ単純に混合した試料を作成した。

質量分析

20 以下の条件で、作成した試料10点について、TOF-MSによる質量分析を 行った。

[表 9]

	X-M1Pc	0=M2Pc	反応条件	TOF-MS分析結果
実施例 1	ClGaPc	TiOPc	実施例1記載	[M-OH] + (1159.3) 選択的 GaPc(1) GPLほぼなし
実施例2	C1GaPc	VOPc	実施例 2 記載	[M-OH] + (1162.6) 選択的 GPL (ほぼなし)
実施例3	C1GaPc	MoOPc	実施例3記載	[M-OH] + (1206.7) 選択的 GaPc(1) GPL (ほぼなし)
実施例4	ClAlPc	TiOPc	実施例4記載	[M-OH] + (1115.8) 選択的 AlPc (m) APL (ほぼなし)
実施例 5	ClAlPc	VOPc	実施例 5 記載	[M-OH]+(1118.7) 選択的 AlPc(1) APL(ほぼなし)

[表10]

	X-M1Pc	O=M2Pc	反応条件	TOF-MS分析結果
実施例 6	C1GaPc	TiOPc (t-Bu) ₄	実施例 6 記載	[M-OH] + (1383.6) 選択的 GaPc(1)
実施例7	ClGaPc (t-Bu)₄	TiOPc (t-Bu)₄	実施例 7 記載	[M-OH] + (1607.5) 選択的 GaPc (1)
比較例 1	ClGaPc: ClAlPc =1:1	-	比較例1記載 (混晶)	M ⁺ (1137) GPL APL
比較例 2	C1GaPc	Ti0Pc	比較例2記載 (単純混合)	M ⁺ (1159.3、なし) GaPc(1)
比較例3	HOGaPc GPLを 含む	TiOPc	比較例3記載 (単純混合)	M ⁺ (なし) GPL/HOGaPc/GaPc(1) TiOPc(s)

表9、表10中の各略号は以下のとおりである。

C1GaPc:クロロガリウムフタロシアニン

C1A1Pc:クロロガリウムフタロシアニン

TiOPc:チタニルフタロシアニン

5

VOPc:バナジルフタロシアニン

MoOPc:オキシモリブデンフタロシアニン

 $GPL: \mu - オキソーガリウムフタロシアニン二量体$

10 APL: μ ーオキソーアルミニウムフタロシアニン二量体

HOGaPc: ヒドロキシガリウムフタロシアニン

(1):ピーク強度大

(m):ピーク強度中

(s):ピーク強度小

5 また、表 9 、表 1 0 の M⁺ および [M – O H] ⁺ は、T O F – M S 分析における異種金属フタロシアニン二量体の親ピーク (P P) を示す。

請求の範囲

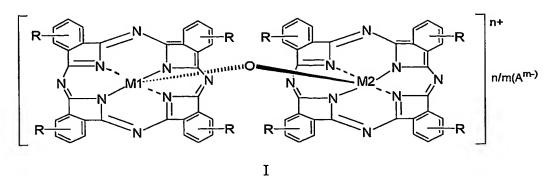
1. 式

5

10

15

20



[式中、M1は最大3の原子価をとることができる金属原子(但しインジウムを除く)を表し、M2は4の原子価をとることができる金属原子を表し、Rはそれぞれ独立して1またはそれ以上の置換基および/または置換原子を表し、(A^m)はm価の対アニオンAを表し、n/mは対アニオンの個数を表し、nはM2の原子価に対応して0または1~3から選択される整数を表し、mは1又は2を表す。]

で示されるμーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物。

- 2. 前記M1が周期表3A族および3B族の金属原子からなる群から選択される、 請求項1記載のμーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物。
- 3. 前記M1がスカンジウム、イットリウム、アルミニウム、ガリウム、インジウム、およびタリウムからなる群から選択される、請求項1記載のμーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物。
- 4. 前記M1がガリウムまたはアルミニウムである、請求項1記載の μ ーオキソ 架橋型異種金属フタロシアニン化合物。
- 5. 前記M2が周期表 $4A\sim7A$ 族、8族、および $4B\sim6B$ 族の金属原子からなる群から選択される、請求項 $1\sim4$ いずれかに記載の μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物。
 - 6. 前記M2がチタン、バナジウム、およびモリブデンからなる群から選択される、請求項請求項 $1\sim4$ いずれかに記載の μ ーオキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物。
- 25 7. 前記M2がチタンである、請求項1~4いずれかに記載のμーオキソ架橋型

10

異種金属フタロシアニン化合物。

- 8. 中心金属がハロゲン化金属(III)であるフタロシアニンと中心金属がオキシ 金属(IV)であるフタロシアニンとを等モルづつ反応させる工程を包含する、請求 項 $1\sim7$ いずれかに記載の μ -オキソ架橋型異種金属フタロシアニン化合物の製造方法。
- 9. 前記ハロゲン化金属 (III) フタロシアニンが、式

Α

[式中、M1は最大3の原子価をとることができる金属原子(但しインジウムを 除く)を表し、Rはそれぞれ独立して1またはそれ以上の置換基および/または

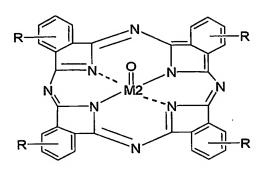
置換原子を表し、Xはハロゲン原子を表す。]

である、請求項8記載の方法。

- 10. 前記M1が周期表3A族および3B族の金属原子からなる群から選択される、請求項9記載の方法。
- 11. 前記M1がスカンジウム、イットリウム、アルミニウム、ガリウム、イン ジウム、およびタリウムからなる群から選択される、請求項9記載の方法。
 - 12. 前記M1がガリウムまたはアルミニウムである、請求項9記載の方法。

10

13. 前記オキシ金属(IV) フタロシアニンが、式

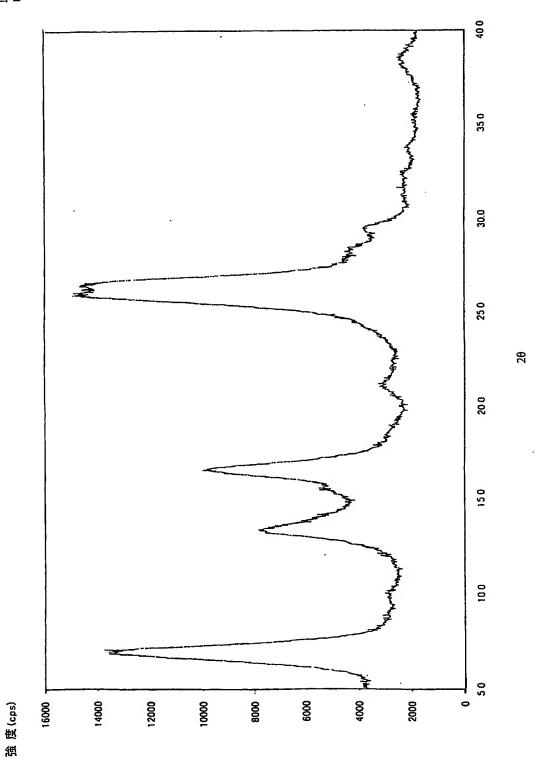


 \mathbf{B}

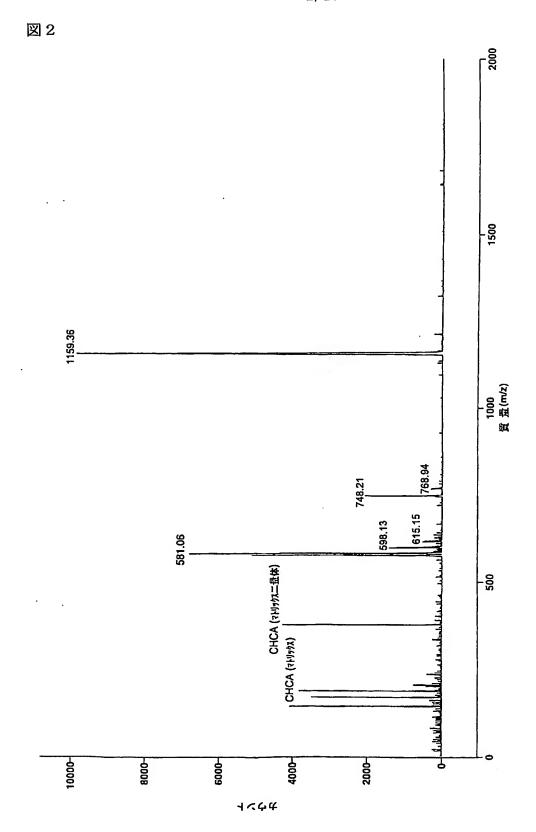
[式中、M2は4の原子価をとることができる金属原子を表し、Rはそれぞれ独立して1またはそれ以上の置換基および/または置換原子を表す。] である、請求項8~12いずれかに記載の方法。

- 14. 前記M2が周期表 $4A\sim7A$ 族、8族、および $4B\sim6B$ 族の金属原子からなる群から選択される、請求項13記載の方法。
- 15. 前記M2がチタン、バナジウム、およびモリブデンからなる群から選択される、請求項請求項13記載の方法。
 - 16. 前記M2がチタンである、請求項13記載の方法。
- 17. 得られた化合物をアンモニア水を用いて洗浄する工程を更に包含する、請求項 $8\sim16$ いずれかに記載の方法。



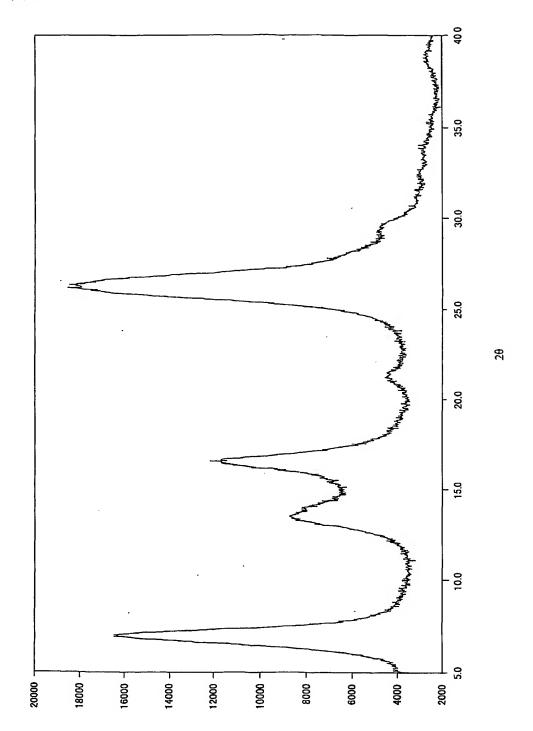


差 替 え 用 紙 (規則26)



差 替 え 用 紙 (規則26)

図3



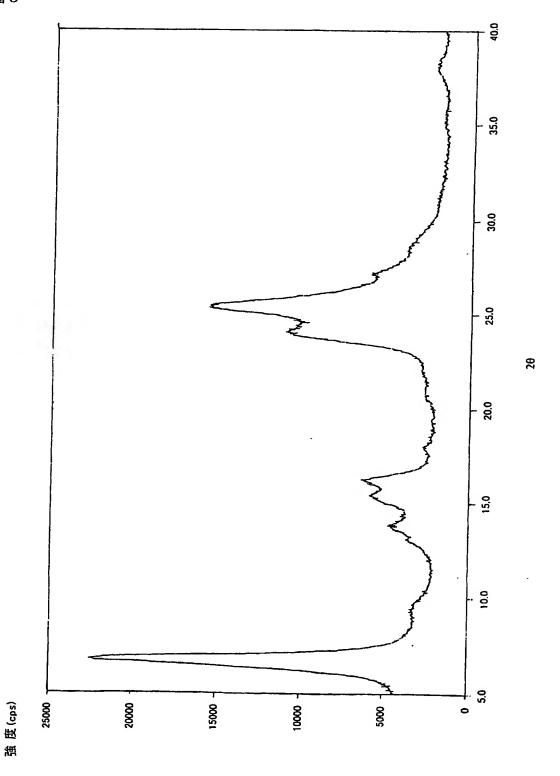




差替え用紙 (規則26)

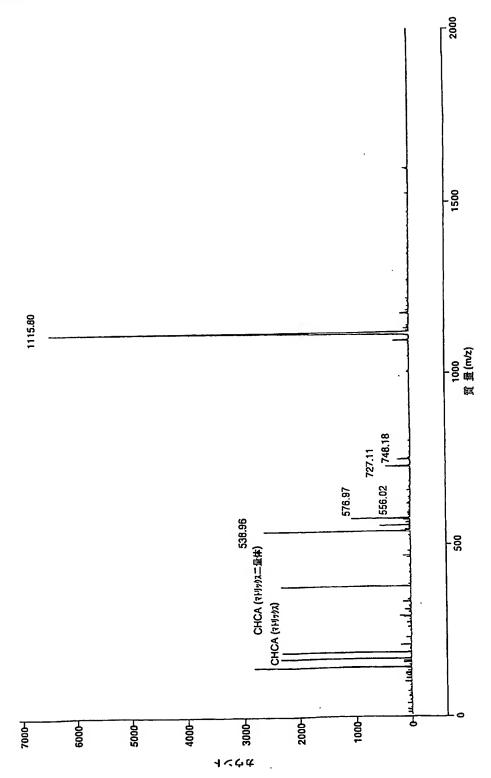
5/13





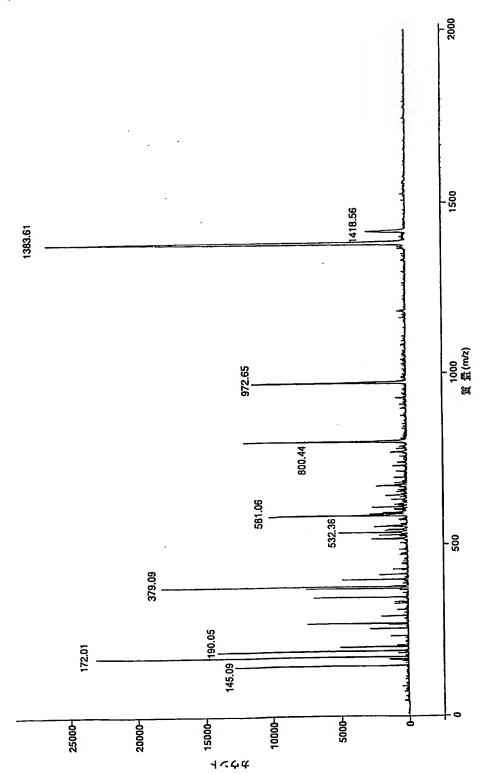
差 替 え 用 紙 (規則26)



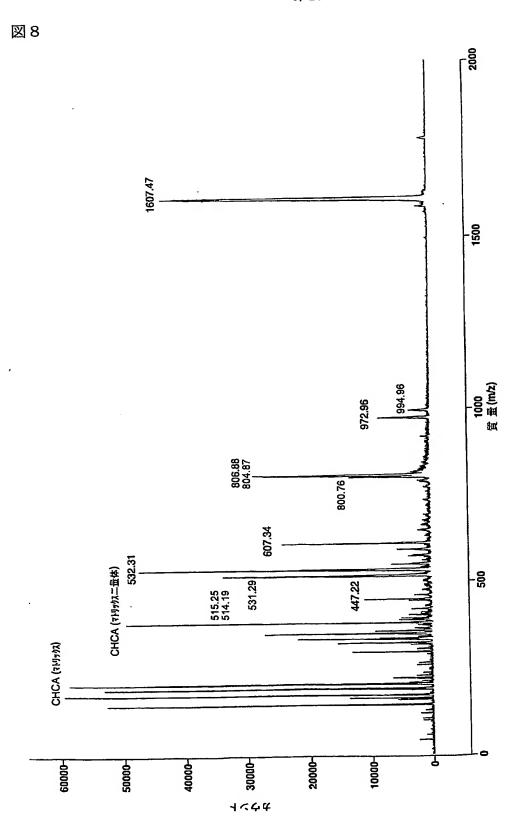


差替え用紙 (規則26)





差替え用紙 (規則26)



差替え用紙 (規則26)

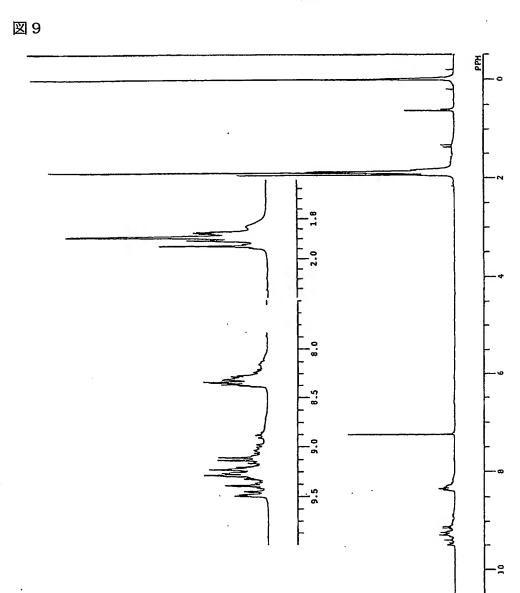


図10

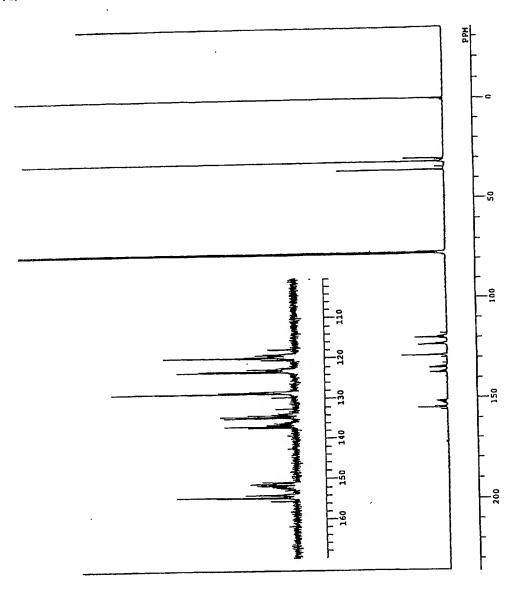
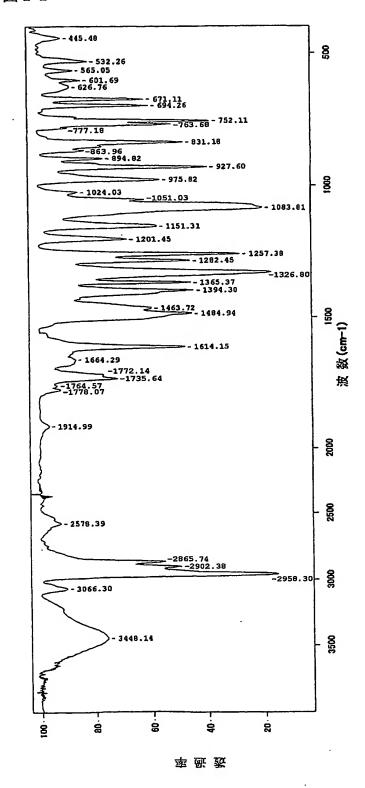


図11



差替え用紙 (規則26)

図12

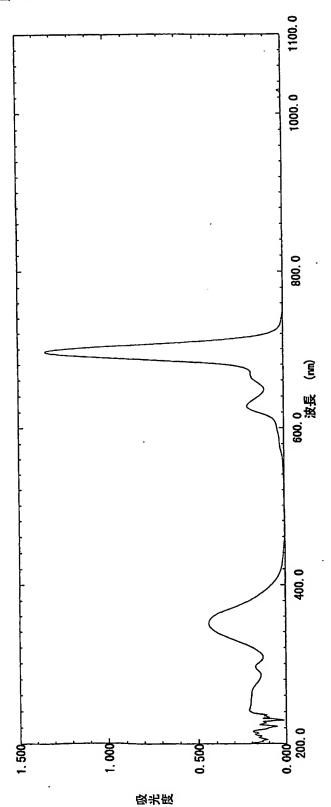
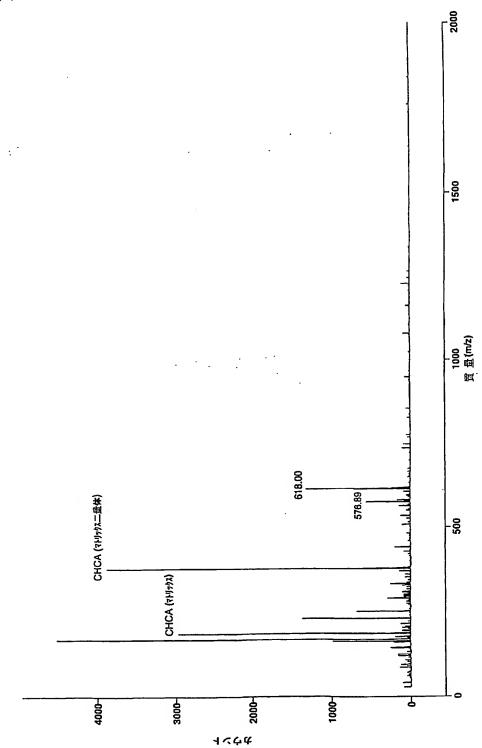
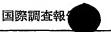


図13



差 替 え 用 紙 (規則26)

A. CLASS Int.	SIFICATION OF SUBJECT MATTER C1 ⁷ C09B47/12, 47/067, 47/08,	C07D487/22, G03G5/06	
According t	o International Patent Classification (IPC) or to both na	tional classification and IPC	
B. FIELD	S SEARCHED		
Minimum d Int.	ocumentation searched (classification system followed to C1 C09B47/12, 47/067, 47/08,	oy classification symbols) C07D487/22, G03G5/06	
Documenta	ion searched other than minimum documentation to the	extent that such documents are included	in the fields searched
	ata base consulted during the international search (name TN), REGISTRY (STN)	e of data base and, where practicable, sear	ch terms used)
C. DOCU	MENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where ap	propriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	JP 6-145550 A (Hitachi Chemi 24 May, 1994 (24.05.94), Full text (Family: none) er documents are listed in the continuation of Box C.	Cal Co., Ltd.), See patent family annex.	1-17
"A" docum consid "E" earlier date "L" docum cited t specia "O" docum means "P" docum than the Date of the	Il categories of cited documents: lent defining the general state of the art which is not lered to be of particular relevance document but published on or after the international filing lent which máy throw doubts on priority claim(s) or which is lent establish the publication date of another citation or other la reason (as specified) lent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other lent published prior to the international filing date but later lent priority date claimed lactual completion of the international search lactual to the international search lactual completion of the international search lactual completion of the international search	"T" later document published after the interpriority date and not in conflict with the understand the principle or theory and document of particular relevance; the considered novel or cannot be considered step when the document is taken alone document of particular relevance; the considered to involve an inventive step combined with one or more other succombination being obvious to a person document member of the same patent Date of mailing of the international sear 09 September, 2003	ne application but cited to erlying the invention cannot be red to involve an inventive claimed invention cannot be be when the document is a documents, such a skilled in the art family
	nailing address of the ISA/ anese Patent Office	Authorized officer	
Facsimile N	io.	Telephone No.	



A. 発明の属する分野の分類(国際特許分類	i (.	IΡ	C)
-----------------------	------	----	----

Int. $C1^7$ C09B47/12, 47/067, 47/08, C07D487/22, G03G5/06

調査を行った分野

調査を行った最小限資料(国際特許分類(IPC))

Int. Cl7 C09B47/12, 47/067, 47/08, C07D487/22, G03G5/06

最小限資料以外の資料で調査を行った分野に含まれるもの

国際調査で使用した電子データベース(データベースの名称、調査に使用した用語)

CA (STN) REGISTRY (STN)

C. 関連すると認められる文献

引用文献の カテゴリー*	引用文献名 及び一部の箇所が関連するときは、その関連する箇所の表示	関連する 請求の範囲の番号
х	JP 6-145550 A (日立化成工業株式会社) 1994.05.24,全文 (ファミリーなし)	1-17
-	·	
;		

C欄の続きにも文献が列挙されている。

- * 引用文献のカテゴリー
- 「A」特に関連のある文献ではなく、一般的技術水準を示す
- 「E」国際出願日前の出願または特許であるが、国際出願日 以後に公表されたもの
- 「L」優先権主張に疑義を提起する文献又は他の文献の発行 日若しくは他の特別な理由を確立するために引用する 文献(理由を付す)
- 「O」ロ頭による開示、使用、展示等に言及する文献
- 「P」国際出願日前で、かつ優先権の主張の基礎となる出願

- の日の後に公表された文献
- 「T」国際出願日又は優先日後に公表された文献であって 出願と矛盾するものではなく、発明の原理又は理論 の理解のために引用するもの
- 「X」特に関連のある文献であって、当該文献のみで発明 の新規性又は進歩性がないと考えられるもの
- 「Y」特に関連のある文献であって、当該文献と他の1以 上の文献との、当業者にとって自明である組合せに よって進歩性がないと考えられるもの
- 「&」同一パテントファミリー文献

国際調査を完了した日

22.08.03

国際調査報告の発送日

09,09,03

国際調査機関の名称及びあて先

日本国特許庁(ISA/JP) 郵便番号100-8915

東京都千代田区霞が関三丁目4番3号

特許庁審査官(権限のある職員) 穴吹 智子

3 2 3 5 4 H

電話番号 03-3581-1101 内線 3443